# บรรณานุกรม


กมล เอี่ยมพนากิจ. (2547). *การศึกษาการเคลือบฟิล์มบางหลายชั้นที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำ*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

จตุพร วุฒิกนกกาญจน์. (2542). การศึกษาสภาพพื้นผิวของโพลิเมอร์ โดยใช้เทคนิค Atomic Force Microscopy. *วารสารเทคโนโลยีวัสดุ*, (15), 46-50.

มติ ห่อประทุม. (2548). *การศึกษาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์โดยการเตรียมด้วยวิธี ดีซี รีแอคทีพ แมกนีตรอน สปัตเตอริง*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

พรนภา สุจริตวรกุล. (2548). กระจกวิเศษ ทำความสะอาดตัวเอง (Self-Cleaning Glass). *CERAMIC Journal*, 69-71.

สรรัตน์ บุญญะหงษ์. (2552). *การเตรียมฟิล์มบางของไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีโซล-เจล สำหรับเคลือบกระจกทำความสะอาดตัวเอง*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

วีรนุช แก้ววิเศษ. (2551). *ผลของการเจือเงินในการเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีโซล-เจล*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

อดิศร บูรณวงศ์. (2551). *สภาพชอบน้ำของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี สปัตเตอริง*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Bally, A. R., Hones, P., Sanjines, R., Schmid, P. E., & Levy, F. (1998). Mechanical and Electrical Properties of fcc $TiO_{1+x}$ Thin Film Prepared by r.f. Reactive Sputtering. *Surface and Coatings Technology, 108,* 166-170.

Barnes, M. C., Kumar, S., Green, L., Hwang, N. M., & Gerson, A. R. (2005). The Mechanism of Low Temperature Deposition of Crystalline Anatase by Reactive DC Magnetron Sputtering. *Surface and Coatings Technology, 57,* 967-971.


มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Chae, S. Y., Park, M. K., Lee, S. K., Kim, T. Y., Kim, S. K., & Lee, W. I. (2003). Preparation of Size-Controlled $TiO_2$ Nanoparticles and Derivation of optically Transparent Photocatalytic Films. *Chemistry of Meterials, 15,* 3326-3331.

Diebold, U. (2003). The Surface Science of Titanium Dioxide. *Surface Science Reports, 48,* 53-299.

GlassonWEb. special glass. (2006, May). *Self-Cleaning glass*. Retrieved from http://www.glassonweb.com/glassmanual/topics/index/selfclean.html

Guan, K. (2005). Relationship between photocatalytic activity, hydrophilicity and self-cleaning effect of $TiO_2/SiO_2$ films. *Surface and Coatings Technology, 191,* 155-160.

Guillard, C., Beaugiraud, B., Dutriez, C., Herrmann, J. M., Jaffrezic, H., Renault, N. J., & Lacroix, M. (2002). Physicochemical properties and Photocatalytic Activities of $TiO_2$ film Prepared by Sol-Gel Methods. *Applied Catalysis B: Environmental, 39,* 331-342.

Hou, Y. Q., Zhuang, D. M., Zhong, G., Zhao, M., & Wu, M. S. (2003). Influence of annealing temperature of the properties of titanium oxide thin film. *Applied Surface Science, 218,* 97-105.

Igor, N. M., & Kenneth, J. K. (2004). Comparative study of $TiO_2$ particles in powder form and as a thin nanostructured film on quartz. *Journal of Catalysis, 225,* 408-416.

Kathirvelu, S., Souza, L., & Dhurai, B. (2008). Nanotechnology Applications in Textiles. *Indian Journal of Science and Technology, 1,* 1-10.

Kim, D. J., Hahn, S. H., Oh, S. H., & Kim, E. J. (2002). Influence of Calcinations Temperature on Structural & Optical Properties of $TiO_2$ Thin Film Prepared by Sol-Gel Dip Coating. *Materials Letters, 57,* 355-360.

Leprince-Wang, Y., & Yu-Zhnag, K. (2001). Study of Growth Prepared by Sol-Gel Dip Coating Morphology of $TiO_2$ Thin Films by AFM and TEM. *Surface and Coatings Technology, 140,* 155-160.

Löbl, P., Huppertz, M., & Mergel, D. (1994). Nucleation and growth in $TiO_2$ films prepared by sputtering and evaporation. *Thin Solid Films, 251,* 72-79.

Maredare, D., Luca, D., Teodorescu, C. M., & Macovei, D. (2007). On the Hydrophilicity of Nitrogen-Doped $TiO_2$ Thin Films. *Surface Science, 601,* 4515-4520.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

McHale, G., Shirtcliffe, N. J., & Newton, M. I. (2004). Contact-Angle Hysteresis on Super-Hydrophobic Surfaces. *Langmuir, 20,* 10146-10149.

Mill, A., Wang, j., Crow, M., Taglioni, G., & Novella, L. (2007). Novel Low-Temperature Photocatalytic Titania Films Produced by Plasma-Assisted Reactive DC Magnetron Sputtering. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 187,* 370-376.

Nakamura, M., Kobayashi, M., Kuzuya, N., Komatsu, T., & Mochizuka, T. (2006). Hydrophilic Property of $SiO_2/TiO_2$ Double Layer Films. *Thin Solid Films, 502,* 121-124.

SAINT GOBAIN GLASS, (2006, August) *Self-cleaning glass*. Retrieved from http://www.saint-gobain-glass.com/exen/a2.html

Sirghi, L., Aoki, T., & Hatanaka, Y. (2002). Hydrophilicity of $TiO_2$ thin films obtained by radio frequency magnetron sputtering deposition. *Thin Solid Films, 442,* 55-61.

Verma, A., Samanta, S. B., Bakhshi, A. K., & Agnihotry, S. A. (2005). Effect of Stabilizer on Structural, Optical and Electrochemical Properties of Sol-Gel Derived Spin Coated of $TiO_2$ Films. *Solar Energy Materials & Solar Cells, 88,* 47-64.

Watanabe, T., Nagajima, A., Wang, R., Minabe, M., Koizumi, S., Fujishima, A., & Hashimoto, Y. (1999). Photocatalytic activity and photoinduced hydrophilicity of titanium dioxide coated glassd. *Thin Solid Films, 351,* 260-263.

Yamagishi, M., Kuriki, S., Song, P. K., & Shigesato, Y. (2003). Thin film $TiO_2$ photocatalyst deposited by reactive magnetron sputtering. *Thin Solid Films, 442,* 227-231.

Zeman, P., & Takabayashi, S. (2002). Effect of total and oxygen partial pressures on structure of photocatalytic $TiO_2$ films sputtered on unheated substrate. *Surface and Coatings Technology, 153,* 93-99.

Zhao, X. T., Sakka, K., Kihara, N., Takada, Y., Arita, M., & Masuda, M. (2005). Structure and photo-induced features of $TiO_2$ thin films prepared by RF magnetron sputtering. *Microelectronics Journal, 36,* 549-551.

Zheng, S. K., Wang, T. M., Xiang, T. M., & Wang, C. (2001). Photocatalytic activity of nanostructured $TiO_2$ thin films prepared by dc magmetron sputtering method deposited by reactive magnetron sputtering. *Vacuum, 62,* 361-366.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University